

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **52117567 A**

(43) Date of publication of application: **03 . 10 . 77**

(51) Int. Cl

H01L 21/26

(21) Application number: **51034173**

(71) Applicant **TOSHIBA CORP**

(22) Date of filing: **30 . 03 . 76**

(72) Inventor: **NAKASUJI MAMORU**

(54) ELECTRONIC BEAM EXPOSURE UNIT

caused by temperature variation for mask formation device, etc., by making the temperature constant directly for mask fixing board or mask substrate.

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent fluctuation of pattern measurement COPYRIGHT: (C)1977,JPO&Japio

特許の種類 (請求項の温度)

⑨日本国特許庁 公開特許公報

①特許出願公開
昭52-117567

⑤Int. Cl².
H 01 L 21/26

識別記号

②日本分類
99(5) C 5

庁内整理番号
7010-57

③公開 昭和52年(1977)10月3日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全2頁)

④電子ビーム露光装置

①特 許 願 昭51-34173
②出 許 願 昭51(1976)3月30日
③發 明 者 中筋護

④出 許 願 人 東京芝浦電気株式会社
川崎市幸区堀川町72番地
⑤代 理 人 弁理士 富岡章 外1名

川崎市幸区小向東芝町1東京芝浦電気株式会社総合研究所内

明細書

1. 発明の名称

電子ビーム露光装置

2. 特許請求の範囲

電子ビーム露光装置に於て、マスク基板又はマスク固定台の温度を直接測定し、基準の温度からのずれがあれば、高温(あるいは低温)物体から直接、放射あるいは伝導によつてマスク基板又はマスク固定台を加熱(又は冷却)することを特徴とした電子ビーム露光装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は電子ビームによるマスク製作装置あるいはウエーハへの直接露光装置に於て、温度変動による熱膨脹によるパターン寸法変動を防止する方法に関する。

6面以上の大さい面積を描画する電子ビーム露光装置では、小さい面積は電子ビームを静電的あるいは電極的に偏向させ、その小さい面積をステップ的あるいは連続的に機械的に移動させ大面積を描画する方法がとられている。この場合、マ

スク等を固定する台は、移動を可能にすべく、ペアリングあるいはコロ、あるいは空気軸受等、点、線、あるいは非金属接触の状態で本体に支えられている。さらに、マスク基板あるいはSiウエーハ等は熱伝導率が小さく、固定台との接触状態は、真空中である点及び容易に離脱可能にするため、熱接触は銀性になつてゐる場合が多い。従つてマスク又はマスク固定台にわずかの熱量のじょう乱があつても、熱抵抗が大きいため、大きい温度変化が生ずる。即ち

$$\Delta T = \Delta Q R_{th}$$

ΔT : 温度変動 (C)、 ΔQ : じょう乱熱量 (W)、
 R_{th} : 热抵抗 (C/W)

温度ドリフトのみ問題になるので、熱容量は無視してある。

この発明の目的は、マスク固定台又はマスク基板温度を間接的ではなく直經恒温化するにある。

真空中の可動物体の温度を測定する手段は、放射温度計が最も便利でこれを利用する。同じく真空中の可動物体への熱エネルギーの授受は放射が

最も容易で、これを利用する。

この発明の実施例を第1図に示す。本体1-1は、温水を流す等の手段によつて温度ドリフトは十分小さく抑えられている。マスク基板固定台1-3はペアリングあるいはコロ1-2を通して点、線あるいは面接触的にしか1-1と熱接触していない、亦的に不安定な状態にあり、わずかの熱じょう乱によつて温度変動を行う。

対物レンズ1-10からの熱放射変動、対物レンズアーバーテヤ1-11からの熱放射、電子ビームによる加熱によるマスク基板1-4は温度変動を行う。放射温度計1-5によつてその温度変動を検出し、增幅し、電子冷熱素子1-8に電流を流し、温度変動を打消す方向に動作させる。1-8は断熱材1-7で本体に支持され、熱の良導体1-9でマスク近くへ熱を運び、マスク基板と対向した熱化された部分を遮じてマスクと熱交換を可能にしている。

マスクの位置決めを行なうレーザ干渉等の距離測定の基準の位置と、電子ビームを照射する位置は

一般に異なるので、マスク基板の温度変動のみでなく、マスク基板と距離測定基準を取付けた固定台の温度変動によつても、マスク寸法に誤差が生ずる。これを避けるために、固定台の温度を測定して、固定台にfeed backを行う必要がある。一方もある。構造的には、固定台の方が大きいので、後者の方法の方が一般には容易である。固定台にfeed backをかけるか、マスク基板にfeed backをかけるか、両方にfeed backをかけるかは、要求されるマスク寸法精度によつて決まる。

本発明を行ななかつた場合、本体1-1を0.1℃の温度精度に保つた場合、1時間で同一のパターンを2枚描画した場合、それぞれ1時間を要したが、最大1.8μmの寸法ずれが見られた。マスク固定台の温度を測定し、そこにfeed backをかけた後、上記と同じ条件で、最大0.3μmの寸法ずれに抑えられた。

マスク基板温度を測定しそこへfeed backをかけた場合は、上と同じ条件で最大0.1μmの寸法ずれがあつたが、これは温度変動によるものかどうか

は不明であり、実質的には、温度変動による影響を無視できる位に小さくできた。

4. 図面の簡単な説明

図1図は本発明の説明図。図において

1-5 放射温度計

1-6 差動増幅器で放射温度計内の測定サーミスタと基準サーミスタとの出力差を符号を含めて增幅し、測定サーミスタがより高温なら電子冷熱素子1-8に吸熱方向に位置を減す。

1-7 断熱支持体

1-9 放射熱交換器。

代理人弁理士　吉岡　章
(ほか1名)

